

目次

中文摘要	i
英文摘要	v
目錄	vii
表目錄	ix
圖目錄	x
符號說明	xii
第一章 緒論	1
1.1 前言	1
1.2 文獻回顧	3
1.2.1 拋光耗材	6
1.3 研就動機及目的	13
第二章 理論分析	13
2.1 何謂化學機械研磨及程序	13
2.2 CMP 研磨廢水現階段處理	15
2.3 被研磨表面上之滑動速度分析	20
2.3.1 靜態分析	21
2.3.2 動態分析	24
第三章 微觀檢測	28
第四章 實驗方法	34
4.1 實驗規劃與流程	34
4.2 實驗參數	34
4.3 實驗變數	34
4.4 限制條件	34
4.5 實驗設備	34
第五章 實驗結果與討論	46
5.1 實驗數據	46
5.2 結果與討論	47
第六章 結論	48
6.1 未來研究方向	48
參考文獻	52